

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成22年7月29日(2010.7.29)

【公開番号】特開2007-206696(P2007-206696A)

【公開日】平成19年8月16日(2007.8.16)

【年通号数】公開・登録公報2007-031

【出願番号】特願2007-22841(P2007-22841)

【国際特許分類】

G 0 3 G 5/14 (2006.01)

G 0 3 G 5/10 (2006.01)

【F I】

G 0 3 G 5/14 1 0 1 F

G 0 3 G 5/10 B

【手続補正書】

【提出日】平成22年6月16日(2010.6.16)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

金属基板または金属化基板と、

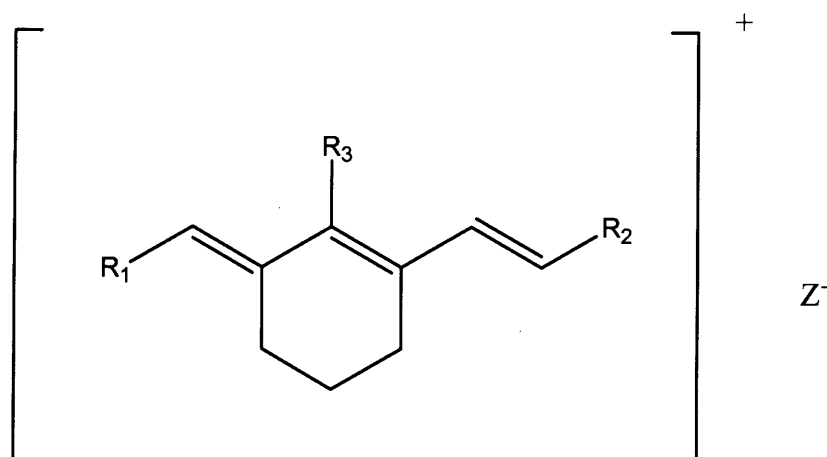
ポリマー樹脂と、約 750 ナノメートルから約 900 ナノメートルの画像形成部材の露光波長で約 100,000 を超えるモル吸光係数を有する近赤外線吸収成分と、を含む、下塗層と、

前記下塗層の上に配置される少なくとも 1 つの追加層と、
を含み、

前記追加層が、電荷発生成分および電荷輸送成分を含み、

前記近赤外線吸収成分が、以下に示す構造式を有する材料を含む、画像形成部材。

【化 1】



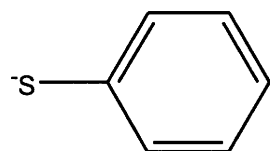
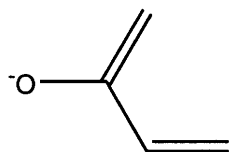
(1)

(上記構造式(1)中、R₁、R₂、およびR₃は同じでも異なってもよく、約1～約30個の炭素を有する炭化水素、アルキル、アルケニル、アルキニル、アリールおよび

複素環置換基から独立して選択され、Zが、以下に示す構造式からなる群から選択され、式中、 X^- は、Br、Cl、 ClO_4 および BF_4 からなる群から選択される。)

る。)

【化2】



および X^-

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

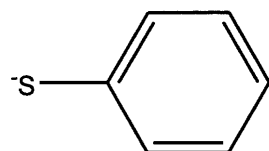
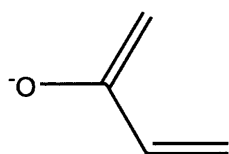
【補正対象項目名】0030

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0030】

【化5】



および X^-